

インタビュー

KIYOSHI SATO

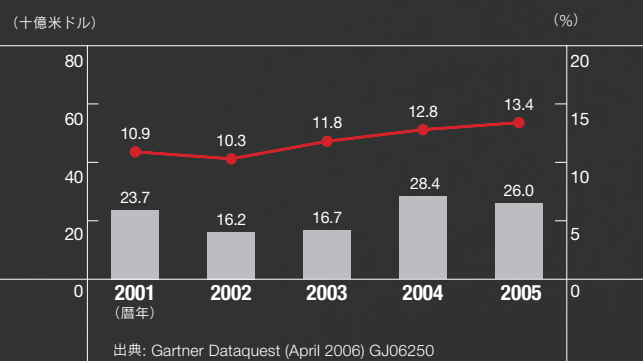
代表取締役社長 佐藤 潔

Q 半導体ウェーハプロセス装置のグローバル市場における東京エレクトロンのシェアが上昇しているようですが、その要因は何でしょうか。

一つは、半導体設備投資におけるアジアでの投資比率の上昇が背景にあります。日本も含めたアジア地域では、メモリーメーカー、ロジックメーカー、ファウンドリーと言った多種多様なお客様が将来を見据えて盛んに設備投資をしていますが、特に前期は、成長ポテンシャルの高いNAND型フラッシュメモリと大容量DRAMに対する投資が大変活発に行われた年でした。当社のアジア地域における顧客バックアップ力が大変強力であることに加えて、当社の製品群が、そうした進化した半導体メモリを始めとするハイエンドの半導体の生産に高いソリューションを提供する製品として評価を受けたことが、当社の成長を牽引したと考えます。

個別には、特に際立った伸長を見せたのがサーフェスプレパレーションシステム(洗浄装置)分野です。3年ほど前までは一桁台のシェアでしたが、プロセスの微細化に伴って300mmウェーハ対応のウェット・ステーションのシェアが一気に35%近くまで上昇しました。これから、2006年3月期に市場投入した新製品が収益に貢献する時期を迎えます。グローバル市場における当社のプレゼンスがさらに上がっていくことを期待しています。

世界半導体前工程製造装置市場とTELの市場シェア



■ 世界半導体前工程製造装置市場
● 東京エレクトロンの市場シェア

Q トップシェアの製品群が多いですが、2番手以下の製品群のシェアアップをどうやって図るのですか。

シェアの向上は大切ですが、利益率を重視しますので、薄利多売は狙いません。勿論、高い営業利益率を達成するためにはある一定の売上規模が必要であることを前提としてですが。

重要なことは、市場と製品のマッチを図ることだと考えます。半導体製造プロセスが高度化する中、お客様のニーズは多様化しています。万人向けの製品をつくろうとすれば製品コンセプトが曖昧になり、差別化戦略も中途半端になります。まず顧客市場を理解し、市場セグメント毎に最適化されたモデルを投入していくことが重要です。

シリコンエッチング装置は市場参入が比較的遅く、シェア拡大の余地を十分に残した製品分野です。シェアはこの1年で10%台に乗り、上昇基調にあります。サーフェスプレパレーションシステム分野では、これまでのウェット・ステーションに加えて、枚葉洗浄装置CELLESTAとプリクリーン装置Certas™の2つの新製品を開発しました。これらの製品ラインアップで、微細化に伴う顧客ニーズの多様化に対応して行きます。

FPDコータ/デベロッパでは第8世代機Exceliner™を今年市場投入しましたが、新しいコンセプトのもと、高性能かつ信頼性の高い装置に仕上がりました。

Q 今後の会社の成長と発展を図る成長戦略についてお話しください。

成長戦略の中核にあるのは、新技術の育成と新製品の開発です。お客様の最大の要求の一つにプロセス性能の向上があり、半導体メモリの大容量化、プロセッサの高速化、低消費電力化の要求の中で、装置メーカーにはさらなる微細化と新材料への対応が求められています。近年はこれに加えて、装置の量産性能の向上が強く求められるようになりました。お客様がどういう技術を必要としているかを迅速にキャッチして、顧客ニーズに基づき製品を創出することが重要であり、付加価値を載せた新モデルをタイムリーに出していくことで、事業を成長させていきます。

また、中長期的なビジョンとして、規模の成長も狙っていきます。そのためには、今の製品分野に加えて、新しいスター的な存

2005年 市場投入の65/45nm向け半導体製造装置(SPE)



液浸プロセス対応コータ/
デベロッパ
CLEAN TRACK™ LITHIUS™++



プラズマアシスト型
バッチCVD装置
TELFORMULA™ IRad



熱処理成膜装置
TELINDY™



枚葉洗浄装置
CELLESTA



プリクリーン装置
Certas™



プラズマエッチング装置
Tactras™

プラズマエッチングチャンバー
SCCM™-JI

在になる製品を創り出してゆくことが必要です。既存技術を最大限に活かしながら新規分野への進出も考え、肅々と研究開発を進めています。

Q 今、装置業界にどのようなことが起きつつあるでしょうか。その中でリーディングポジションを維持していくには何が重要になるのでしょうか。

第一に、半導体や液晶業界をみると、大規模メーカーによる寡占化がますます進み、大型投資を継続できるお客様は世界でも少なくなっています。このように寡占化が進んだ市場では受注するための戦いが益々激化するでしょう。営業・サービス・工場ともにお客様を徹底的にサポートし、ビジネスの信頼関係を構築していかなければなりません。それには、品質の向上と最善のサポート、そして真の顧客要求への迅速な対応が何より重要になります。

第二に、装置業界においても今後の成長や生き残りをかけた戦いが激化していきます。大手装置メーカーは、当社も含めて、今後の成長のためにそれぞれ新規分野への参入を考えてきます

ので、今後はコア製品の分野で競争が激しくなる可能性があります。ここでの解決策は技術開発力です。優れたプロセス性能や量産性能を持った装置はお客様の生産性向上やコストダウンに貢献し、大きな支持が得られます。次にアライアンスやM&Aでしょう。単独では開発期間が長期化するケースにおいては、大学やパートナー企業との開発アライアンスが有効となり、さらなる場合によってはM&Aも選択肢となりうるでしょう。

Q 最後に、東京エレクトロンのDNAは何でしょうか。

東京エレクトロンの歴史の中で連綿と受け継がれてきた“顧客重視の姿勢”、“Venture Spirit”そして“変化への対応力”などがそうだと思います。変化に対して守勢に入れば、それは縮小を意味し、攻勢に転ずれば発展の可能性をもたらします。東京エレクトロンは過去においても市場の要請の変化に積極的に適応して大きく発展してきました。代理店からメーカーへ転身したのもそうですし、日本市場からグローバル市場へ進出したのもそうです。市場の変化に対する感性を高めて、東京エレクトロンのさらなる成長のチャンスを見出していきたいと思います。

成長のための研究開発を加速
高水準の研究開発費と世界の研究開発拠点

IMEC (ベルギー)
IMECとの間でArF液浸露光技術開発およびEUV露光技術開発における共同研究が進行中

関西テクノロジーセンター
(兵庫県尼崎市)

先端プロセス開発センター
(山梨県韮崎市)

TEL Technology Center, America, LLC
(ニューヨーク)

IMECについて
IMECは、ナノエレクトロニクスおよびナノテクノロジーに関する研究機関であり、次世代半導体/製造装置、ならびに要素技術を中心とした研究に取り組んでいます。

